ВЛИЯНИЕ МИКРОВКЛЮЧЕНИЙ НА ОПТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ В СРЕДНЕМ ИК ЛИАПАЗОНЕ

В. Г. Артюшенко, Е. М. Дианов

УДК 535.341

Измерены коэффициенты объемного и поверхностного поглощения излучения на длинах волн I,06,5+6 и I0,6 мкм, а также коэффициенты рассеяния на I0,6 мкм в образцах промышленных кристаллов NaCl, кСl, кВг и Сві. Измеренные величины сопоставлены с концентрацией микровключений в кристаллах, определенной ультрамикроскопическим методом.

Проблема получения высокопрозрачных материалов для мощных инфракрасных лазеров привлекает к себе в последнее время большое внимание. Одним из классов таких материалов, в частности. являются шелочно-галоидные кристаллы (ШГК). В ряде работ /І - 4/ было показано, что фундаментальное многофононное поглощение в этих кристаллах в среднем ИК диапазоне экспоненциально убывает с ростом частоти. В получаемых сейчас ШТК экспериментально измеренные величины коэффициентов поглощения на длинах волн 1,06, 5,25 и 10,6 мкм /1,3 - 5/, как правило, превышают уровень фундаментального поглощения, что обусловлено наличием в них поглощающих примесей. Концентрация примесей, приводящих к поглощению $\beta_{-} = 10^{-4} \text{ см}^{-1}$ на длине волны $\lambda = 10,6$ мкм, может быть чрезвычайно низкой (например, для кс. достаточно 10 $^{-7}$ % С10 $_{2}$ /6/). На оптические потери также может существенно влиять форма вхождения примеси в кристалл. Одной из таких форм являются микровключения, в которых примесь находится в собственной фазе. В 1962 году авторы работы /7/ обнаружили с помощью ультрамикроскопии в кристаллах NaCl, KCl, KBr и Lif наличие отдельных микровключений размером от нескольких сотен до несколько тысяч ангстрем

с концентрацией от 10^5 до 10^7 см $^{-3}$. По данным /7/, интенсивность рассеяния света в кристаллах в диапазоне 300-700 нм коррелировала с величиной концентрации микровключений в них.

В известной нам литературе не удалось обнаружить данных об измерениях зависимости коэффициентов поглощения и рассеяния в среднем ИК диапазоне от содержания микровключений в ШГК. Поэтому нами были измерены коэффициенты объемного и поверхностного поглощения на длинах волн 1,06, 5 + 6 и 10,6 мкм, а также коэффициент рассеяния на 10,6 мкм в кристаллах NaCl, квг и Cal.

Била сделана оценка размеров и концентрации микровключений в этих кристаллах. Концентрация микровключений сопоставлена с коэффициентами рассеяния и объемного поглощения, а также с уровнем содержания примесей, определенным спектрофотометрическим методом.

Методика измерений. Спектры пропускания исследованных образцов ЩТК были получены на спектрофотометре ИКС-29 с компенсацией поверхностного поглощения в опорном дуче тонкой пластинкой исследуемого материала /4/. Так как чувствительность в определении коэффициента поглощения из спектров пропускания повышается с увеличением длины образца, измерения производились на кристаллах длиной 1 = 10 см. Коэффициенты объемного и поверхностного поглощения измерялись методом лазерной калориметрии /8/ с использованием лазера YAG: $Nd^{3+}(\lambda = 1,06 \text{ мкм})$, CO_2 -лазера $J\Gamma$ -22 $(\lambda = 10.6 \text{ мкм})$ и отпаянного СО-лазера, работавшего при комнатной температуре и генерировавшего несколько десятков линий в диапазоне от 5 до 6 мкм. Для ультрамикроскопии мы использовали криптоновый лазер мощностью 200 мВт на длине волны 0,647 мкм в качестве источника освещения микровключений, которые наблюдались под прямым углом к лучу с помощью микроскопа с фотонасадкой. Измерения рассеяния производились на длине волны = 10,6 мкм с использованием в качестве приемника излучения фотосопротивления HgCdTe, которое располагалось под прямым углом к лучу лазера. Іля измерений использовались промышленные кристаллы NaCl, KBr, CsI M KCl.

Результаты. В спектрах пропускания всех исследованных кристаллов, кроме образца КС1 №3, были обнаружены полосы примесного поглощения. Наиболее интенсивными были примесные полосы в Св1.

Таблица І

Коэффициенты объемного да и поверхностного в поглощения в образцах маС1, кС1, кВг и СвІ на длинах волн I,06, 5+6 и I0,6 мкм, а также коэффициенты рэдеевского рассеяния у на I0,6 мкм и концентрация микровключений. Всличины минимальных измеренных взяты из работ /I,3,4,9,10/.

Длина волны, мкм	1,06			5 + 6			10,6					
Параметры образцов	10 ⁴ 5, cm ^{-I}		7.4	10 ⁴ p cm ^{-I}		4777	10 ⁴ , cm ^{-I}		204	10 ⁷ X 1	Концентра- ция микро-	
	эксп.	MEHEM. SKCII.	104 p a	эксп.	MMHMM. ORCII.	1078	ercn.	MEHRIM SKCIL		1 1 1	cm-I	CM-3
NaCl .	2,6	0,07	3,6	I,8	0,34	9	IO	II	II	65	2	-
KCl N1	13	0,07	13	I,9	0,02	2,7	12	0,7	0,7	6	4	105
KC1 H2	17	0,07	6	2,5	0,02	2	18	0,7	0,7	Ĩ	IO	105+ 106
KC1 N3	0,8	0,07	0,3	I,2	0,02	2	2,9	0,7	0,7	I,5	2	104
KBr	0,5	0,03	I,3	1,3	-	3,2	II	0,002	0,002	I,6	2	104+ 105
CsI	27	dite	53	6,2	-	I,4	140	-	-	55	40	106

Идентификация этих полос показала наличие примесей 10^2 ,

Ультрамикроскопическое исследование образцов показало наличие микровключений с размерами порядка 10^2-10^3 й при концентрациях 10^4-10^6 см $^{-3}$. Длина волны освещения $\lambda=0,647$ мкм в несколько раз превышала размеры микровключений, поэтому они выглядели под микроскопом как светящиеся точки. Из—за дифракции на краю объектива точки были окружены концентрическими кольцами, диаметр которых увеличивался по мере смещения микровключения из фокальной плоскости (рис. I). В случае, когда два микровключе—

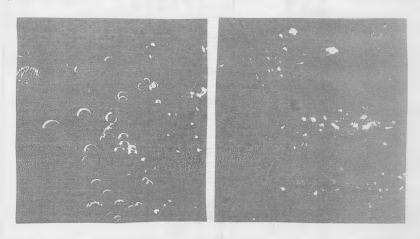


Рис. І. Микровключения в кристаллах ксі. Увеличение в І50 раз

ния находились на расстоянии ~ 10 мкм, на дифракционные кольца накладивалась система интерференционных полос, перпендикулярных прямой, соединяющей микровключения (рис. 1). Мы нашли, что в образцах с высокой концентрацией микровключений (кс1 и св1) микровключения имели размеры порядка ~ 10³ А и были распределены по объему относительно равномерно, а в образцах с меньшей концентрацией (кс1 к1, кс1 к3, квт) микровключения размером порядка ~ 10³ А в основном декорировали границы олоков и дислокаций.

Почти для всех исследованных нами образцов величины коэффициентов объемного поглощения и особенно, коэффициентов рассеяния коррелировали с концентрацией микровключений (табл. I).
Исключением является образец NaCl, в котором не удалось обнаружить
вилимых микровключений. Это, по всей видимости, объясняется тем,
что методом ультрамикроскопии на длине волны 0,647 мкм при экспозиции I мин можно обнаружить только достаточно крупные микровключения (более IOO A). Более мелкие микровключения, конечно,
участвуют в процессах поглощения и рассеяния излучения. То,
что в виде крупных микровключений содержится только часть при-

меси, подтверждает тот факт, что изменение концентрации микровключений на порядок и более сопровождается изменением поглощения и рассеяния в образцах КС1 & 2 и & 3 всего в несколько раз. Хотя объемная доля крупных микровключений в исследованных нами кристаллах относительно невелика (при концентрации 10^6 см $^{-3}$ микровключений размером 10^3 & их объемная доля составляет 10^{-9} и не является

основной причиной примесного поглощения), она почти во всех образцах коррелирует с уровнем поглощения (табл. I), так как,

по-видимому, является карактеристикой, отражающей общий уровень содержания примесей в исследованных образцах ЩТК.

Крупние микровключения более существенно влияют на уровень рассеяния, так как он является квадратичной функцией объема рассеивающих центров. Что касается поверхностного рассеяния на исследованных образцах, то наши измерения показали, что оно существенно превышает уровень объемного рассеяныя в отличие от рассеяния в видимом диапазоне. Это объясняется различной зависимостью коэффициентов объемного и поверхностного поглощения от длины волны. Поверхностное поглощение (табл. 1) обусловлено,

по-видимому, загрязнением поверхности в процессе обработки и адсородией воды. Поверхности скола (образцы КС1 №2 и №3) имели в основном более низкий уровень поверхностного поглощения, чем оптически полированные (остальные образцы).

Поступила в редакцию 27 мая 1980 г.

Литература

- 1. B. Bendow, J. Electr. Mater., 3, N 1, 101 (1974).
- 2. T. C. McGill, Opt. Prop. of Highly Transp. Sol., Plenum Press, N.-Y., 1975, p. 3.
- 3. M. Hass, B. Bendow, Appl. Opt., 16, 2882 (1977).
- 4. T. F. Deutsch, J. Phys. Chem. Sol., 34, 2091 (1973).
- 5. Е. С. Букова и др., ОМП, № 12, 29 (1977).
- 6. M. Flannery, M. Sparks, Proc. of Simp. "Laser Induced Damage in Opt. Mater.", NBS Boulder, Colorado, 1977.
- K. G. Bensigir, E. E. Schneider, J. Appl. Phys., Suppl., 33, 383 (1962).
- 8. В. Г. Артюненко, Е. М. Дианов, Е. П. Никитин, Квантовая электроника, <u>5</u>, № 5, IO65 (1978).
- 9. S. D. Allen, J. E. Rudisill, Appl. Opt., 16, 2914 (1977).
- 10. S. D. Allen, J. A. Harrington, Appl. Opt., <u>17</u>, 1679 (1978). 11. H. E. Bennet, Opt. Eng., <u>17</u>, 480 (1978).